

**KINETIKA KRISTALIZACIJE
SILICIJUM-(IV)-NITRIDA**
**KINETICS OF CRYSTALLIZATION
SILICON-(IV)-NITRIDE**

DRAGANA STOJIĆ, NENAD RADOVIĆ,
TATJANA VOLKOV-HUSOVIĆ

*Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu,
Srbija i Crna Gora*

Primljeno: 14. 04. 2003

IZVOD

Amorfna kovalentna Si-C-N keramika je dobijena pirolizom polisilazana. Ovaj deo eksperimenta je vršen na Institutu za nemetalne neorganske materijale u Štutgartu, Nemačka. Keramika je zagrevana na konstantnoj temperaturi od 1500°C u toku različitog vremena. Upoređene su strukturne promene u toku različitog vremena zagrevanja, u inertnoj atmosferi azota. Takođe, istraživana je kristalizacija i kinetika kristalizacije Si_3N_4 korišćenjem Avrami jednačine.

Ključne reči: kovalentna Si-C-N keramika, piroliza, polisilazan, kristalizacija, Si_3N_4 , Avrami jednačina.

ABSTRACT

Amorphous covalent Si-C-N ceramics have been synthesized by pyrolysis polysilazanes. This part of experiment was done in Institute für Nichtmetallische Anorganische Materialien, Universitaet Stuttgart, Germany. Ceramics was heated at constant temperature, 1500°C, in different times. Structural changes due the different heating times in an inert nitrogen atmosphere are compared. Also, kinetics of Si_3N_4 crystallization was investigated by using Avrami equation.

Key words: covalent Si-C-N ceramics, pyrolysis, polysilazanes, Si_3N_4 , Avrami equation.

1. UVOD

Priprema keramike od organskih elemenata [1] može da se podeli u četiri faze:

- sinteza prekeramičkih oligomera ili polimera do monomernih jedinica
- njihovo unakrsno vezivanje do dvo- ili trodimenzionalnih prekeramičkih šema

- organo-neorganska transformacija (transformacija šeme u amorfnu keramiku visokim temperaturama)
- kristalizacija amorfne čvrste faze u termodinamički stabilnu fazu, preko različitih metastabilnih faza

Ova tehnologija dobijanja keramike, omogućava homogenu raspodelu elemenata na osnovnom nivou i kontrolu mikrostrukture na nižim temperaturama. Sinteza i unakrsno vezivanje dozvoljavaju kontrolu fizičkih i hemijskih karakteristika polimera. Samim tim, omogućeno je pripremanje monolita kovalentne keramike pirolizom, tj. supstanca se razgrađuje zagrevanjem.

Keramički materijali tipa Si-C-N spadaju u grupu nitrida sa izuzetno jakom kovalentnom vezom, pa se iz tog razloga dobijaju pirolizom², jer je njihovo sinterovanje dosta otežano. Ova keramika je mešavina silicijuma, ugljenika, azota i slobodnog ugljenika. Opšta formula je $\text{SiCnSi}_3\text{N}_4\text{x C}$.

Proizvodnja keramike se sastoji iz dva koraka:

- tečni predhodnik se lije u kalup pogodnog oblika i unakrsnim vezivanjem formira polimer
- slobodne forme su pirolizovane u intervalu od 400°C do 900°C, pod kontrolisanim uslovima tečenja Si-C-N.

Pirolizom se organski materijal transformiše u neorganski, koga karakteriše dobra vatrostalnost (temperatura na kojoj ne dolazi do degradacije mehaničkih osobina utvrđenih standardom). Ovaj materijal postaje postojan na temperaturama iznad 1800°C. Namena ovog materijala je za izradu vatrostalnih obloga, za izradu termometara koji se koriste za merenje temperature tečnog aluminijuma, kao i u mnoge druge svrhe. Cilj rada je određivanje kinetike kristalizacije $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$.

2. EKSPERIMENT

U ovom radu je korišćen uzorak Si-C-N koji je dobijen iz Instituta za nemetalne neorganske materijale u Štutgartu (Institut für Nichtmetallische Anorganische Materialien, Universitaet Stuttgart, Germany).

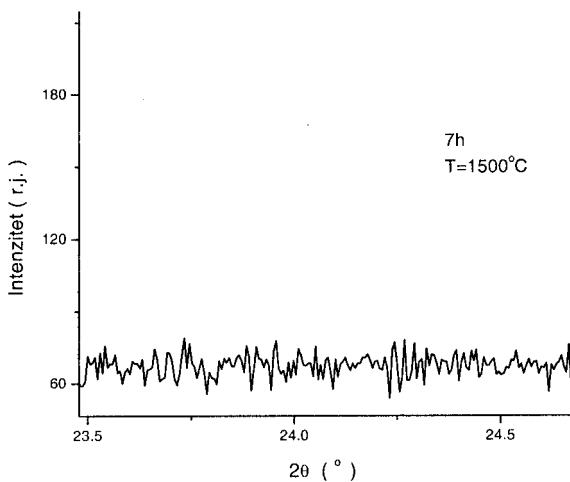
Uzorak Si-C-N je dobijen pirolizom. Zatim je zagrevan u automatskoj peći za žarenje u inertnoj atmosferi azota. Zagrevanje je vršeno na konstantnoj temperaturi od 1500°C. Pritisak azota u peći je između 960-970 mbar. Vreme zagrevanja je od 7 h do 168 h.

Izvršeno je trinaest žarenja sa ukupnim vremenom žarenja od 168 h.

Nakon svakog žarenja površina uzorka posmatrana je XRD-om. Dobijeni su difraktogrami, na osnovu kojih je određena kinetika kristalizacije Si-C-N keramičkog sistema.

3. REZULTATI

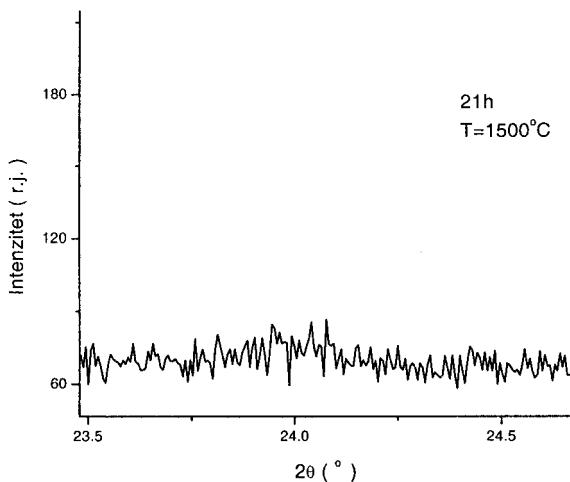
Iz difraktograma (slika 1.) vidi se da nakon 7 h žarenja na 1500°C ne dolazi do izdvajanja Si₃N₄.



Slika 1 - Difraktogram Si-C-N makon žarenja od 7 h, na 1500°C

Figure 1 - X-ray diffraction Si-C-N after annealed for 7 h, at 1500°C

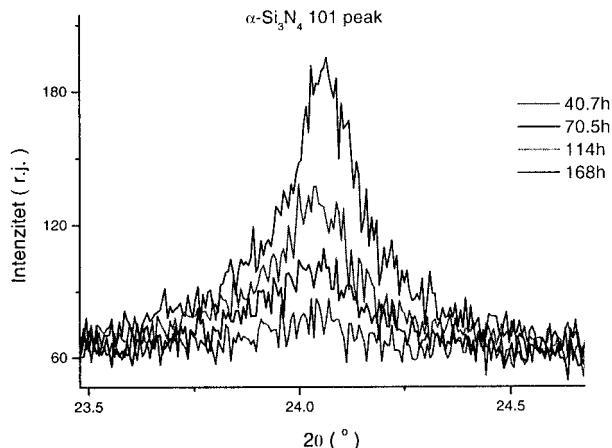
Posle žarenja u trajanju od 21 h zapaža se pojava blagog pika, na 23.998°. Žarenje se vrši takođe na temperaturi od 1500°C, slika 2.



Slika 2 - Difraktogram Si-C-N nakon žarenja od 21 h, na 1500°C

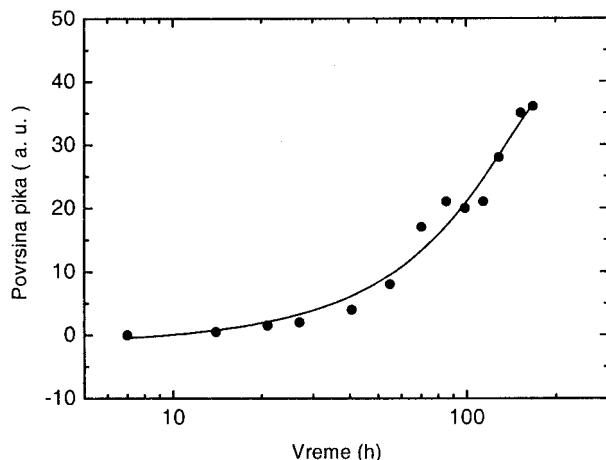
Figure 2 - X-ray diffraction SI-C-N after annealed for 21 h, at 1500°C

Na slici 3. dat je uporedni prikaz kristalizacije sa produžavanjem vremena žarenja. Sa produženjem vremena žarenja dolazi do povećanja površine pika i intenziteta X-zraka.



*Slika 3 - Difraktogram Si_3N_4 na 1500°C pri različitim vremenima žarenja
Figure 3. X-ray diffraction Si_3N_4 on 1500°C on different times annealed*

Na slici 4. je prikazana zavisnost ukupne površine pika od vremena. Sa produžavanjem vremena žarenja površina pika se povećava. Minimalna površina pika je pri vremenu žarenja od 7h i iznosi 0a.u. Maksimalna površina pika je kada je završena kristalizacija, pri vremenu od 168h i iznosi 36a.u.



*Slika 4 - Zavisnost površine pika od vremena žarenja
Figure 4 - Dependence size pique of time annealed*

4. DISKUSIJA

Na slici 1. ne zapaža se nikakva promena u strukturi. Predpostavlja se da žarenjem u trajanju od 7 h dolazi samo do pregrupisavanja elemenata u okviru ovog sistema, tj. da kristalizacija nije započela. Kao rezultat pregrupisavanja elemenata javljaju se tri područja. Prvo područje je oblast gde se u strukturi javlja samo $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$. Drugo područje je oblast SiN. On je izuzetno nestabilan, tako da se brzo razgrađuje, i poslednja oblast je oblast SiC. Razlaganje drugog područja ide na račun povećanja $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$ i SiC područja.

Posle žarenja u trajanju od 21 h može se zapaziti pojava blagog pika, slika 2. Može se zaključiti da je kristalizacija $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$ samo započela.

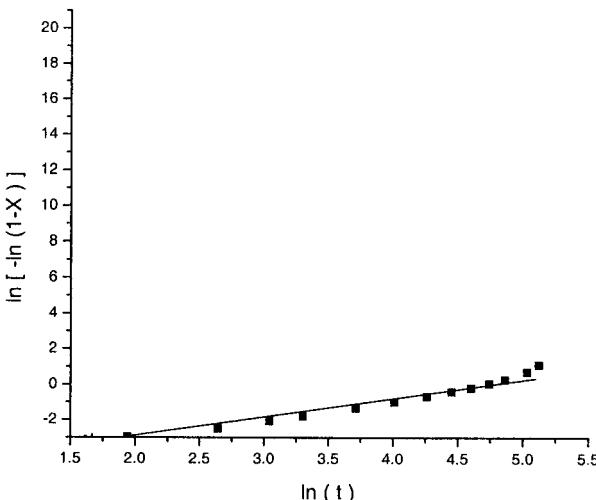
Tokom kristalizacije, uočili smo da ne dolazi samo do izdvajanja $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$. Iz ovog razloga nije dovoljno samo da se kristalizacija posmatra poređenjem površine pika. Ovo bi bilo moguće u slučaju da se 100% izdvaja $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$. Kako ovo nije moguće da se postigne, jer uvek može da se desi da je zaostala manja količina SiC, onda je određujen molski udio kristalne faze u zavisnosti od vremena žarenja.

Za opisivanje kinetike procesa koji se odvija, mehanizma, nastajanja klica I njihovog rasta, koristi se poluempijska Avrami jednačina. Ona važi za uslov $T=\text{const}$. Dobijene vrednosti su uvršćene u Avrami³ jednačinu, koja glasi:

$$X = 1 - \exp(-kt^n)$$

X-molski udio iskristalisane faze; k-konstanta brzine hemijske reakcije; t-vreme žarenja; n-red reakcije;

Kao rezultat gore navedenog dobija se sledeća grafička zavisnost, slika 5.



Slika 5 - Zavisnost $\ln[-\ln(1-X)]-\ln(t)$
Figure 5 - Dependence $\ln[-\ln(1-X)]-\ln(t)$

Iz nagiba ove prave određen je red reakcije, koji iznosi 0.84. Zaključeno je da se kristalizacija odigrava na granici faza, odnosno radi se o jednodimenzionoj kristalizaciji. Ovo je zaključeno na osnovu toga što red reakcije teži 1, tačnije iznosi 0.84. Iz ovoga sledi Avrami jednačina, koja opisuje kristalizaciju na 1500°C, glasi

$$X=1-\exp(-0.00674t^{0.84})$$

5. ZAKLJUČAK

U ovom radu ispitivana je kinetika kristalizacije kovalentne keramike Si-C-N dobijena pirolizom polisilazana. Ovako sintetisana keramika je žarena u inertnoj atmosferi azota na konstantnoj temperaturi od 1500°C, pritisku azota 960-970 mbar. Vreme žarenja se kreće od 7 h do 168 h.

Utvrđeno je da kristalizacija α -Si₃N₄ započinje nakon 21 h žarenja. Ako bi se poredili pikovi nakon različitih vremena žarenja, zapaža se da se smanjuje njihova širina, sa povećanjem količine α -Si₃N₄. Kao rezultat toga smanjuje se količina SiC, što dovodi do smanjenja "širine" pika, a povećava se "visina", odnosno intenzitet X-zraka.

Kinetika je posmatrana na osnovu Avrami jednačine.

ZAHVALNICA

Autor Dragana Stojić se zahvaljuje Institutu za metalurgiju, TU Klaustal, Nemačka (Institut für Metallurgie, Technische Universität Clausthal), kao i profesorima Günter Borchardt i Haraldu Schmidt na pruženoj pomoći u toku izrade eksperimentalnog dela ovog rada.

LITERATURA

- [1] J. Bill, F. Adlinger; Precursor-Derived Covalent Ceramics, *Adv. Mater.* 1995, 7, No. 9
- [2] Li-Anne Liew, Wenge Yhang An, Sandeep Shah, Ruiling Luo, Yuping Liu, Tsali Cross, Martin L. Dunn, Victor Bright, Johu W. Daily, Rishi Raj; *American Ceramic Society Bulletin*, Vol. 80, No. 5
- [3] Angus P. Wilkinson, Jamer S. Speck, Anthony K. Cbeetham, Srinivasan Natarajan, John Meuring Thomas; *Chem. Mater.* 1994, 6, 750-754
- [4] D. Stojić, Diplomski rad, TMF, Beograd, 2003.